

PACS numbers: 61.46.Hk, 68.37.Lp, 68.55.J-, 73.50.Lw, 73.61.At, 73.63.Bd, 81.15.Ef

Двошарові плівки Cu/наночастинки Ni/підкладка

В. О. Зленко, С. І. Проценко

*Сумський державний університет,
вул. Римського-Корсакова, 2,
40007 Суми, Україна*

Одержано тонкі плівки Ni на поліімідних підложжях методою термічного випаровування у вакуумі. Виконано апробацію методики одержання рівномірно розподілених по поверхні полімерного підложжя масивів металічних наночастинок шляхом диспергування тонких плівок Ni під час термовідпалювання у вакуумі. Досліджено мікроструктуру та терморезистивні властивості тонкоплівкового твердого розчину (Cu, Ni), одержаного на основі диспергованих плівок ніклю.

Thin films of Ni on polyimide substrates are fabricated by thermal evaporation in a vacuum. Approbation of technique for fabrication of arrays of the metal nanoparticles uniformly distributed over the polymer substrate by dispersion of thin Ni films during a thermal annealing in a vacuum is performed. Microstructure and thermoresistive properties of thin-film (Cu, Ni) solid solution obtained on the base of dispersed nickel films are studied.

Получены тонкие пленки Ni на полииидных подложках методом термического испарения в вакууме. Выполнена апробация методики получения равномерно распределенных по поверхности полимерной подкладки массивов металлических наночастиц путем диспергирования тонких пленок Ni при термическом отжиге в вакууме. Исследована микроструктура и терморезистивные свойства тонкопленочного твердого раствора (Cu, Ni), полученного на основе диспергированных пленок никеля.

Ключові слова: термічне випаровування, диспергування плівок, металеві наночастинки, термічний коефіцієнт опору.

(*Отримано 17 червня 2011 р.*)

1. ВСТУП

Розроблення та удосконалення метод одержання упорядкованих ма-

сивів металевих наночастинок з можливістю контролю їх структурно-фазового стану, форми та морфології залишається на сьогодні актуальним як з точки зору вивчення фізичних властивостей, так і використання масивів наночастинок у мікроелектроніці, сенсорній техніці, медицині тощо. Багато робіт присвячено методам хемічної синтези наночастинок, які не завжди забезпечують можливість контролювати вищевказані параметри. До того ж застосування таких методів у більшості випадків пов'язане з необхідністю виключення або зменшення поверхневої взаємодії між одержуваними частинками шляхом введення сурфактантів, закріплення на поверхні чи в об'ємі інертної матриці. Так у роботі [1] розглядається методика синтезу наночастинок Ni з нітрату ніклю та олеату натрію. Зазначена можливість контролю розміру одержуваних частинок за допомогою зміни температури розкладання сполук. У той же час відсутній механізм контролю форми частинок та спостерігається часткова оксидізація, яку дослідники пояснюють поверхневою адсорбцією молекул олеату на поверхні наночастинок Ni. У роботі [2] описаний процес одержання нанорозмірних частинок ніклю з розчину $\text{NiCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$. Хоча розмір частинок залежить від температури синтезу та початкової концентрації розчину, контроль їх форми залишається досить складною задачею. Синтеза наночастинок Fe–Ni з Ni(ІІ)-ацетіл-ацетонату та Fe(ІІІ)-ацетілацетонату описана в роботі [3], в якій зазначена можливість управління морфологією та розміром одержуваних наночастинок шляхом введення сурфактантів у розчини, що реагують.

Дана робота присвячена вивченняю методики одержання рівномірно розподілених масивів наночастинок Ni на поверхні полімерної підкладки шляхом диспергування тонких металевих плівок при термо-відпалюванні у вакуумі. Наведені результати дослідження морфології та терморезистивних властивостей одержаних на основі диспергованих плівок ніклю тонкоплівкових твердих розчинів (Cu, Ni).

Згідно з діяграмою фазових станів Cu та Ni на всьому проміжку концентрації компонент утворюють твердий розчин [4], параметер гратниці якого залежить від концентрації складових згідно з Вегардовим правилом. Дане твердження експериментально підтверджено в роботах різних авторів, хоча використання різних методик та умов одержання стопів дає різне узгодження з вищевказаним правилом. Плівкові стопі (Cu, Ni) привертають до себе увагу з точки зору деяких особливостей їх магнетних властивостей таких як сильна перпендикулярна анізотропія, обмінна взаємодія, мікрохвильовий гігантський магнетоопір та ін. (як це відмічено в роботах [5, 6, 7]). Є також деякі роботи, присвячені дослідженю терморезистивних властивостей. Так, у роботі [8, 9] наведено результати дослідження термічного коефіцієнта опору та питомого опору для різних товщин та концентрацій тонкоплівкових (Cu, Ni), одержа-

них роздільним термічним випаруванням компонент у вакуумі. Не дивлячись на вищезазначене, можна зробити висновок, що дослідження магнетних та електрофізичних властивостей даного матеріалу мають незакінчений характер, а тому є перспективним напрямком для подальшого вивчення.

2. МЕТОДИКА ЕКСПЕРИМЕНТУ

Термостійкі полімерні підкладки для нанесення тонких металевих плівок і подальшого дослідження їх мікроструктури були одержані з розчину поліамідної кислоти з піромелітового діангидриду та 4,4'-дiamінодіfenілового етеру (вміст сухого залишку 21%), змішаної у об'ємному співвідношенні 1:5 з розчинником діметілфорамідом, на мідних мікроскопічних сітках (розмір комірки 100 мкм). Процес імідізації (хемічний перехід до твердого стану і перетворення на поліімід (ПІ)) виконувався протягом 40 хв. у вакуумній камері устати ВУП-5М при температурі 420 К і тиску залишкової атмосфери 10^{-3} Па. Товщина одержуваних поліімідних підкладок складала менше 100 нм.

Для дослідження терморезистивних властивостей тонких металевих плівок як підкладки використовувалися ситалові пластини з попередньо нанесеними на них поліімідними плівками.

Плівки ніклю та міді осаджувались на поліімідні та поліімід/ситалові підкладки в єдиному циклі термічним випаровуванням у вакуумі. Контроль ефективної товщини здійснювався методою кварцового резонатора. Дослідження мікроструктури зразків виконувались за допомогою просвітнього електронного мікроскопа ПЕМ125-К.

Одержання острівцевих структур та масивів наночастинок Ni відбувалося в результаті процесу диспергування тонких плівок при термовідпалюванні у вакуумі [10].

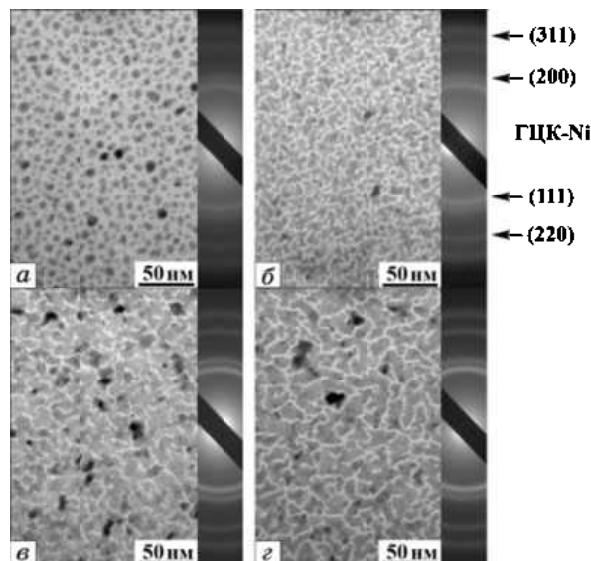
3. РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ

Виконані за допомогою просвітньої електронної мікроскопії дослідження структури та фазового складу щойносконденсованих на поліімідні плівки-підкладки тонких плівок Ni з ефективною товщиною 1,5–3,5 нм показали, що зразки мали нанодисперсну структуру та гранецентровану кубічну кристалічну гратницю. Присутність інших фаз, таких як оксиди чи нітріди, не спостерігалася. Параметри гратниці експериментальних зразків (a) і масивного матеріалу (a_0) наведено у табл. 1.

Для одержання масивів металевих наночастинок виконувалось термооброблення плівок Ni на поліамідних (ПІ) та поліімід/ситалових (ПІ/С) підкладках в єдиному циклі у вакуумі протягом 1 год.

ТАБЛИЦЯ. Параметри гратниці тонких плівок Ni.

Товщина плівки, нм	a , нм
Ni(1,5)	0,354
Ni(2,5)	0,353
Ni(3)	0,353
Ni(3,5)	0,352
\bar{a} (Ni) = 0,353 нм; a_0 (Ni) = 0,353 нм [11]	

**Рис. 1.** Мікроструктура плівок Ni/ІІІ, відпалених до $T = 720$ К з початковою ефективною товщиною Ni 1,5 нм (а), 2,5 нм (б), 3,0 нм (в) та 3,5 нм (г).

при різних максимальних температурах відпалювання. Швидкість нагрівання складала 5–15 К/хв. Знімки мікроструктури та електронограми від відпалених до різних температур зразків наведено на рис. 1, 2. При зменшенні початкової ефективної товщини плівок ніклю відбувається перехід від суцільної плівки до острівцевих структур та, згодом, до масивів наночастинок.

Мікрознімки свідчать про те, що при температурі відпалювання 720 К відбулося диспергування плівки ніклю з початковою ефективною товщиною 1,5 нм та утворення масиву наночастинок. Зразки з більшою початковою ефективною товщиною мають суцільну структуру. Збільшення температури відпалювання до 800 К привело до диспергування плівки з початковою ефективною товщиною 2,5 нм і утворення острівцевих структур. З електронограм видно, що всі зразки мають ГЦК-структурну, дифракційні кільця від інших спо-

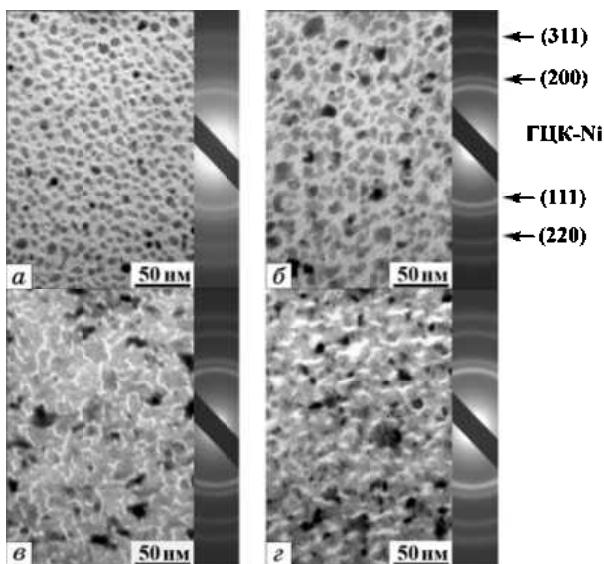


Рис. 2. Мікроструктура плівок Ni/ПІ, відпалених до $T = 800$ К з початковою ефективною товщиною Ni 1,5 нм (а), 2,5 нм (б), 3,0 нм (с) та 3,5 нм (д).

лук не спостерігаються.

За допомогою власно розробленого програмного забезпечення [12] була виконана аналіза морфології масивів одержаних металевих наночастинок, результати якого приведені на рис. 3.

Розрахований коефіцієнт заповнення для наведених на рис. 1, а та рис. 2, а масивів наночастинок складає 38,5% та 32,1% відповідно. Якщо проаналізувати експериментальні дані, то можна зробити висновок, що збільшення температури відпалювання призводить до звуження гістограми розподілу із незначною зміною розмірів наночастинок у більший бік. Це пояснюється коалесценцією менших за розміром частинок і перехід до більш вигідного з енергетичної точки зору стану.

Одержані в результаті відпалювання при $T = 800$ К плівки Ni/ПІ та Ni/ПІ/С використовувалися в єдиному циклі як підкладки для наступного осадження Cu. Ефективна товщина одержаного шару міді склала 5,5 нм. Як вже було зазначено вище, Ni та Cu можуть утворювати твердий розчин на всьому проміжку концентрацій компонент а величина параметра кристалічної ґратниці змінюється у відповідності з Вегардовим правилом. На рисунку 4 приведена залежність параметра кристалічної ґратниці твердого розчину Cu–Ni від концентрації Ni. На графіку показані одержані нами експериментальні результати, дані з літературних джерел та залежність у відповідності з Вегардовим правилом для масивного матеріалу. Як можна бачити, експериментальні результати задовільно корелюють

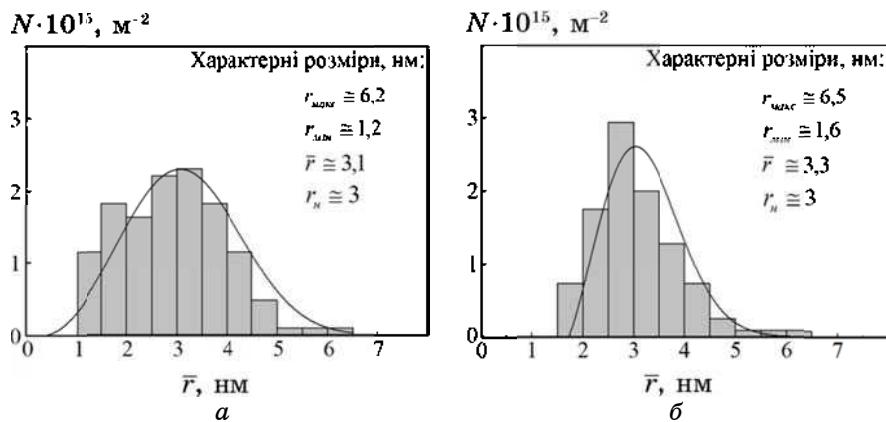


Рис. 3. Гістограми розподілу наночастинок Ni за розміром, утворених у результаті відпалювання тонких плівок з початковою ефективною товщиною 1,5 нм при $T = 720$ К (а) та $T = 800$ К (б). На вставках: r_{\max} , r_{\min} , \bar{r} та r_h — максимальний, мінімальний, середній та найбільш ймовірний радіуси частинок відповідно.

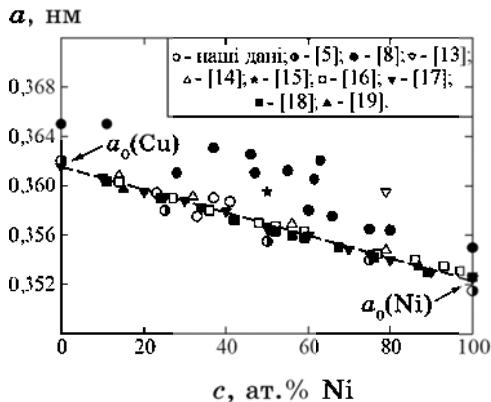


Рис. 4. Залежність параметра кристалічної ґратниці твердого розчину (Cu, Ni) від концентрації атомів Ni.

з іншими літературними джерелами.

Результати мікроскопічного дослідження одержаних систем (Cu, Ni)/ПІ зображені на рис. 5. Зразки мають чітко виражену лябірінтоподібну мікроструктуру та ГЦК-тип кристалічної ґратниці. Також присутня незначна кількість фази оксиду міді Cu_2O з параметром кристалічної ґратниці 0,423–0,426 нм.

На наступному етапі роботи були досліджені терморезистивні властивості систем (Cu, Ni)/ПІ/С у процесі відпалювання їх у вакуумі. На рисунку 6 приведені експериментально одержані графіки

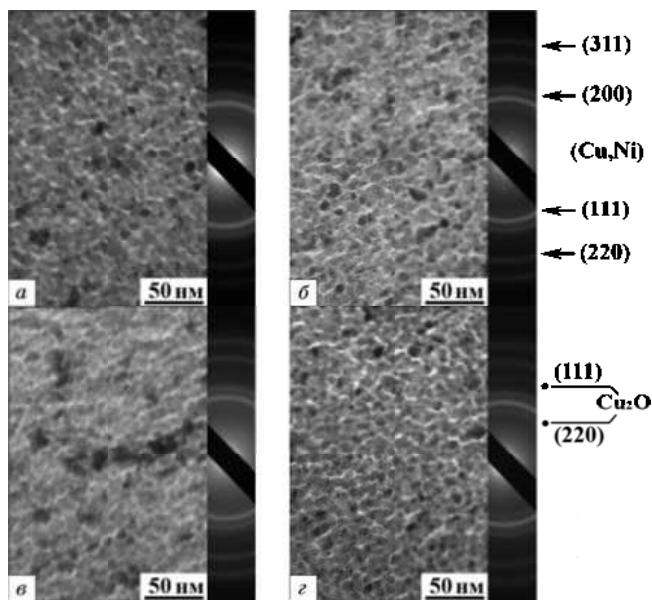


Рис. 5. Мікроструктура та електронограми від одержаних плівкових стопів. Ефективна атомова концентрація c , ат.% Ni: 23 (a), 33 (b), 37 (c) та 59 (d).

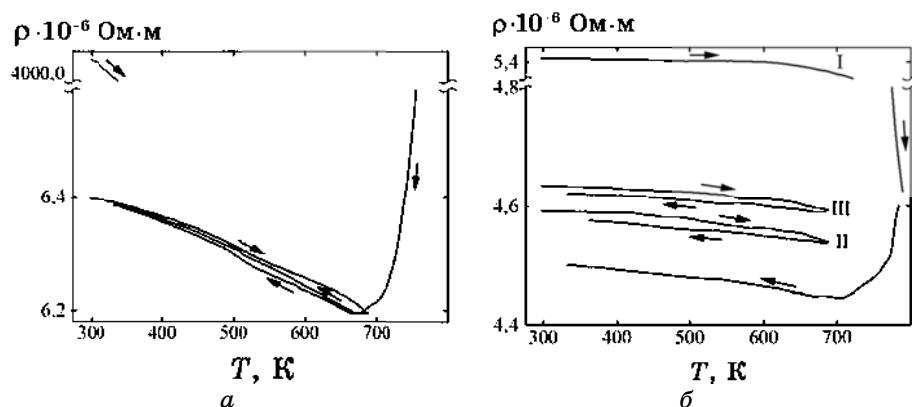


Рис. 6. Температурна залежність питомого опору для систем (Cu, Ni)/ПІ/С. Ефективна атомова концентрація c , ат.% Ni: 33 (a) та 37 (b).

залежностей питомого опору від температури зразків з ефективною атомовою концентрацією Ni $c = 33, 37$ ат.%. З'ясувалося, що досліджувані зразки мали від'ємний коефіцієнт термічного опору $\beta = -0,21 \cdot 10^{-4}$ та $-0,09 \cdot 10^{-4} \text{ К}^{-1}$ відповідно.

Середня енергія активації острівцевої провідності, обчислена за експериментальними даними, для систем (Cu, Ni)/ПІ/С (ефективна

атомова концентрація c , ат.% Ni: 33 та 37) склала $5,6 \cdot 10^{-4}$ еВ.

4. ВИСНОВКИ

Розглянутий в роботі процес диспергування тонких металевих плівок на поверхні полімерної підкладки під час термовідпалювання у вакуумі дозволяє одержувати рівномірно розподілені по поверхні підкладки масиви наночастинок Ni, розміри яких можна контролювати добором початкової ефективної товщини плівок, температури та часу відпалювання.

Розрахунки параметрів кристалічної ґратниці зразків (Cu, Ni) свідчать про утворення твердого розчину вже на стадії конденсації Cu. Одержані експериментально від'ємні значення коефіцієнта термічного опору (ТКО) характерні для острівцевих структур. Згідно з даними, наведеними в роботі [9], ТКО для надтонких плівок стопу (Cu, Ni) змінюється з від'ємного на додатний при досягненні товщини близько 3,5 нм (перехід від термічно активованої провідності до звичайної металевої), що не співпадає з одержаними результатами. Це можливо пов'язано з утворенням оксиду міді та доволі сильно структурованою морфологією зразків.

ЦИТОВАНА ЛІТЕРАТУРА

1. S.-G. Kim, Y. Terashi, A. Purwanto, and K. Okuyama, *Coll. Surf. A*, **337**: 96 (2009).
2. H. Wang, X. Kou, L. Zhang, and J. Li, *Mater. Res. Bull.*, **43**: 3529 (2008).
3. Y. Chen, X. Luo, G.-H. Yue, X. Luo, and D.-L. Peng, *Mater. Chem. Phys.*, **113**: 412 (2009).
4. Н. П. Лякишев, *Диаграммы состояний двойных металлических систем* (Москва: Машиностроение: 1997).
5. В. Г. Мягков, Л. Е. Быкова, Г. Н. Бондаренко, В. С. Жигалов, *Письма в ЖЭТФ*, **88**, № 8: 592 (2008).
6. C. A. Vaz, J. A. C. Bland, and G. Lauhoff, *Rep. Prog. D: Appl. Phys.*, **71**: 056501 (2008).
7. B. K. Kuanr, S. Gokhale, M. Vedpathak, A. V. Kuanr, and G. Nimtz, *J. Phys. D: Appl. Phys.*, **33**: 34 (2000).
8. В. Б. Лобода, С. М. Пирогова, С. І. Проценко, *Вісник Сумського державного університету. Серія Фізика, математика, механіка*, № 3(24)–4(25): 74 (2001).
9. В. Б. Лобода, С. Н. Хурсенко, *ЖЭТФ*, **130**: № 5(11): 911 (2006).
10. В. О. Зленко, С. І. Проценко, *Металофиз. новейшие технол.*, **33**, № 4: 496 (2011).
11. С. С. Горелик, Ю. А. Скаков, Л. Н. Растворгусев, *Рентгенографический и электронно-оптический анализ. Приложения* (Москва: Металлургия: 1970).
12. В. А. Зленко, С. И. Проценко, *Материалы IX международной научно-практической конференции «Образовательные, научные и инженерные*

приложения в среде LabVIEW и технологии National Instruments» (Москва: 2010), с. 153.

13. N. Rajasekaran and S. Mohan, *J. Appl. Electrochem.*, **39**: 1911 (2009).
14. R. P. van Ingen, R. H. J. Fastenau, and E. J. Mittemeijer, *J. Appl. Phys.*, **76**: 1871 (1994).
15. B. N. Mondal, A. Basumallick, and P. P. Chattopadhyay, *J. Alloys Comp.*, **457**: 10 (2008).
16. F. Lihl, H. Ebel, A. Reichl, and A. Kaminitzschek, *Z. Met. Kd.*, **59**: 735 (1968).
17. B.-J. Lee and J.-H. Shim, *CALPHAD*, **28**: 125 (2004).
18. B. R. Coles, *J. Inst. Met.*, **84**: 346 (1955).
19. A. K. Jena, D. Gulati, and T. R. Ramachandran, *Z. Met. Kd.*, **72**: 847 (1981).